

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl.⁷
H05B 33/10

(11)
(43)

10-2005-0011320
2005 01 29

(21)

10-2003-0050348

(22)

2003 07 22

(71)

()

275-7

(72)

910 901

(74)

:

(54)

;

;

;

가 .

1

, mass sensor, , , , EL

1

2

3

가 .

, 2 가

2), (CF₄) 가 , 가 (SF₆), (Cl

1

(10) (20) (11) (14)
(15a)가 (15) (30) 가
(15a)가 .

(20) 가 .

, (mass sensor; 60) (62) (10)
, (15) ()

, (50) (60) (50)가 ,
(15) (15) (40)가 .

(50) 가 ,

(60) (50)가
(50) RF , 가 , (CF₄) 가

가 RF 가 (60)

, 가 가

(60)

, 가 , 가

2

(10) (70)가 (80) (80)
(10)

(70) (74) , , 가 .

(60) (72) (74) (74)

, (70) (60) (90)가 .

, (70)
 (80) 가 , (90) RF 가 , (60)
 CF 4) 가 RF 가 (80)
 , 가 가 , (10) 가 ,
 , (10) 2 (70) (70)
 3
 2 , (6) (72) (72) (70)
 가
 , (72)가 () (72) (60)가
 (70) (10)
 2
 가
 , 가
 가
 , 2

(57)

1.

;

2.

가

3.

가

4.

2 3 , 2 가

5.

1 3 ,

6.

5 가 , 가 (SF₆), (Cl₂), (CF₄)

7.

1 3 ,

8.

1 3 ,

9.

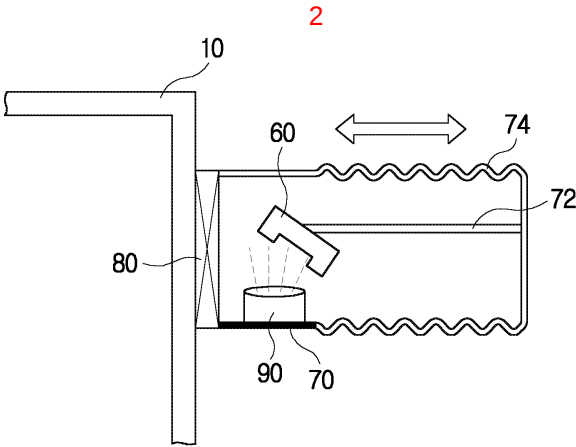
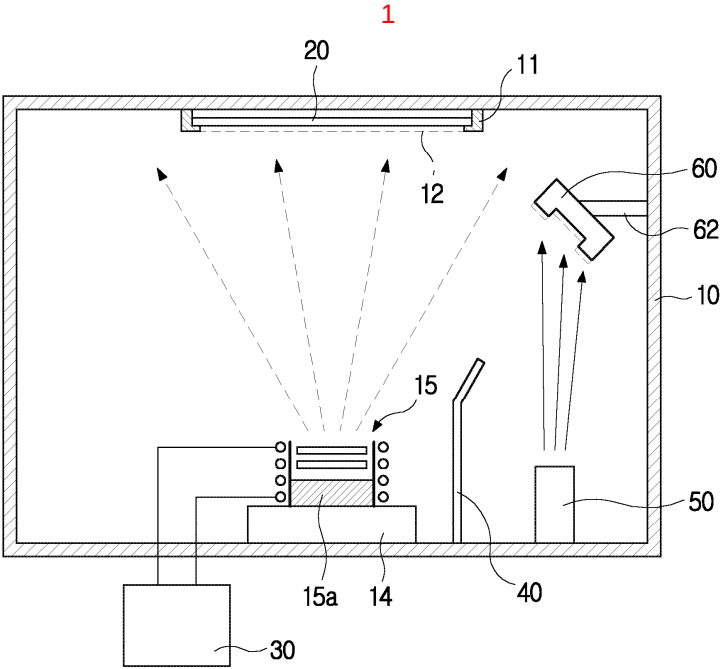
1 3 ,

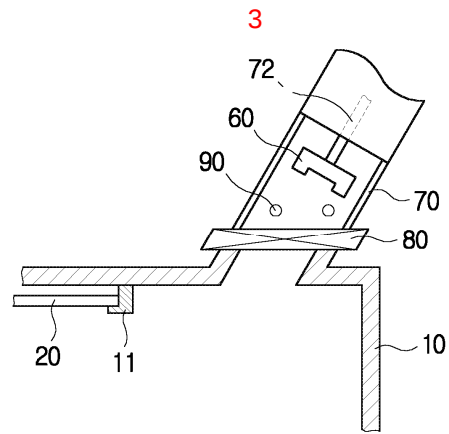
10.

2

3

11.





专利名称(译)	材料沉积设备		
公开(公告)号	KR1020050011320A	公开(公告)日	2005-01-29
申请号	KR1020030050348	申请日	2003-07-22
[标]申请(专利权)人(译)	金信CHEUL Gimsincheol		
申请(专利权)人(译)	Gimsincheol		
当前申请(专利权)人(译)	Gimsincheol		
[标]发明人	KIM SHINCHUL		
发明人	KIM,SHINCHUL		
IPC分类号	H05B33/10		
CPC分类号	C23C14/243 C23C14/542 H01L51/001		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

沉积室，其中安装有用于沉积特定材料的基板；沉积室中提供的沉积源与基板相对；一种质量传感器，用于测量沉积在基板上的物质的厚度；并且清洁源设置在沉积室中，与质量传感器的前表面相对应，以去除沉积在质量传感器上的物质。1 指数方面 清洁，质量传感器，石英晶体，污染，沉积，有机EL

